

1.5 LITERATURA

1. Eder J. M.: *History of Photography*. Columbia University Press, New York 1946.
2. Gernsheim H., Gernsheim A.: *The History of Photography*. Thames and Hudson, London 1969.
3. Šalda J., Svoboda L.: *Přehled polygrafie*. SPN, Praha 1978.
4. Noyce R. N.: *Sci. Amer.* 237, 63 (1977).
5. Brit. pat. 565.
6. Deckert C. A., Ross D. L.: *J. Electrochem. Soc.* 1980/3, 45C.
7. de Forest W. S.: *Photoresist Materials and Processes*. McGraw-Hill, New York 1971.
8. Jorgense G. W., Bruno M. H.: *The Sensitivity of Bichromated Coatings*. Bull. 218, Lithography Tech. Foundation, New York 1954.
9. Ostroff E.: *J. Photogr. Sci.* 17, 65 (1969).
10. Hopher M.: *J. Photogr. Sci.* 12, 181 (1964).
11. Kosar J.: *Light Sensitive Systems*. Wiley, New York 1965.
12. Thompson L. F., Wilson C. G., Bowden M. J.: *Introduction to Microlithography*. ACS Symposium Series 219, ACS, Washington 1983.
13. USA pat. 2 441 960.
14. Shipley Company: *Data Sheet DS-12A* (firemní literatura, Newton, leden 1960).
15. Vossen J. L., Kern W.: *Thin Film Processes*. Academic Press, New York 1978.
16. Young E. S.: *Fundamental of Semiconductor Devices*. McGraw-Hill, New York 1978.
17. Donocik R.: *Elektronika materiálů*. Skriptum ČVUT. ČVUT, Praha 1981.
18. Anonym: *Science* 189, 540 (1975).
19. Aspinall D.: *Electronics and Power* 1976, 437.
20. Grove A. S.: *Physics and Technology of Semiconductor Devices*. Wiley, New York 1967.
21. Forester T.: *The Microelectronic Revolution*. MIT Press, Cambridge 1980.
22. Anonym: *Sci. Amer.* 237, 3 (1977).
23. Robinson A. L.: *Science* 208, 1019 (1980).
24. Newman P. C.: *Electronics and Power* 1976, 444; Anonym: *Semicond. International* 7/9, 62 (1984), 7/10, 80 (1984).
25. Minsk L. M., Smith Y. G., Van Deusen W. P., Wright J. F.: *J. Appl. Polymer Sci.* 2, 302 (1959).

26. USA pat. 2 725 372.
27. USA pat. 2 690 966.
28. Brit. pat. 708 384.
29. Brit. pat. 767 985.
30. Dunham K. R.: *Solid State Technol.* 14/6, 71 (1971).
31. Doane D. A.: *Solid State Technol.* 23/8, 101 (1980).
32. King M. C., Muraski E. S.: *Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng.* 174, 70 (1979).
33. King M. C.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-26, 711 (1979).
34. Herriot D. R., Brewer G. R.: *Electron-Beam Lithography Machines in Electron-Beam Technology and Microelectronic Circuit Fabrication*. Academic Press, New York 1981.
35. Herriot D. R., Collier R. J., Alles D. S., Statford J. W.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 385 (1975).
36. Varnell G. R., Hebley D. F., Robbins R. R., Carpenter C., Malone J. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 17, 1787 (1980).
37. Alles D. S., Ashley F. R., Johnson A. M., Townsend R. L.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1252 (1975).
38. Pfeiffer H. C.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 887 (1978).
39. Weber E. V., Moore D. R.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1980 (1979).
40. Yorke H. S., Weber E. V.: *Tech. Digest. IEDM 1976*, 431.
41. Hall T. M., Wagner A., Thompson L. F.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1889 (1979).
42. Broes A. N.: *Physics Today* 11, 38 (1979).
43. Seliger R. L., Kubena R. L., Vlney R. D., Ward J. N., Wang V. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1610 (1979).
44. Fay B., Trotel J., Petroff Y., Pinechaux R., Thiry R.: *Appl. Phys. Lett.* 29, 370 (1976).
45. Moldonado J. R., Coquin G. A., Maydan D., Somekh S.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1329 (1975).
46. Spears D. L., Smith H. I.: *Electron Lett.* 8, 102 (1972).
47. Feder R., Spiller E., Topalin J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1332 (1975).
48. Lacombat M., Dubroeuq G. M.: *Proc. SPIE* 174, 28 (1979).
49. Lin B. J.: *Fine Line Lithography* (Newman R., Edit.). North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1980.
50. Lehmann H. W., Widmer R.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 319 (1978).
51. Bondur J. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 1023 (1978).
52. Mittal K. L.: *Solid State Technol.* 22/5, 89 (1979).
53. Walker E. J.: *IEEE Trans. Electron Devices*, ED-22, 464 (1975).
54. Hatzkis M.: *IBM J. Res. Develop.* 24, 425 (1980).
55. Reichmanis F., Wilkins C. W., Jr., Chandross E. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* 19, 133 (1981).
56. Jinno K.: *Jap. J. Appl. Phys.* 17, 1283 (1978).
57. Grant B. D., Clecak N. J., Twieg R. G., Willson C. G.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-28, 1300 (1981).
58. Jelcov A. V., Jurre T. A., Guk Je. G.: *Ž. Tech. Fiz.* 1, 571 (1975).

59. Smith J. N., Hughs H. G., Keller J. V., Goodner W. R., Wood T. E.: *Semiconductor International* 1979, 41.
60. Willson C. G., Ito H., Fréchet J. M. J., Houlihan F.: *Proceedings of IUPAC 28th Macromolecular Symposium*, Amherst, July 1982.
61. Fréchet J. M. J., Ito H., Willson C. G.: *International Conference on Microlithography*, Grenoble, Oct. 1982.
62. Viswanathan N. S.: *2nd International Bubble Memory Conference*, Santa Barbara, December 1981.

1. Widmann D., Stein K. U.: *Proc. 2nd Eur. Solid State Circuits Conf.*, Solid State Circuits 29, 1977 (1976).
2. Cuthbert J. D.: *Solid State Technol.* 20/8, 59 (1977).
3. Born M., Wolf E.: *Principles of Optics*. 4th Ed., Pergamon Press, New York 1970.
4. Lin B. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1317 (1975).
5. Smith H. I.: *Proc. IEEE* 62, 1361 (1974).
6. Mimura Y., Ohkubo, T., Takeuchi T., Sekikawa K.: *Jap. J. Appl. Phys.* 17, 541 (1978).
7. Doane D. A., Fraser D. B., Hess D. W.: *Proc. Tutorial Symp. on Semicond. Technol.* 82/5, 119 (1982).
8. Melngalis J., Smith H. I., Efremov N.: *IEEE Trans. Electron Devices ED-22*, 496 (1975).
9. Markle D. A.: *Solid State Technol.* 17/6, 68 (1974).
10. Cuthbert J. D.: *Solid State Technol.* 20/6, 42 (1977).
11. Einspruch N. G.: *VLSI Electronics Microstructure Science*. Academic Press, New York 1981.
12. Wilcznski J. S., Tibbetts R.: *IBM J. Res. Develop.* 13, 192 (1969).
13. Bruning J. H.: *J. Vac. Sci. Technol.* 17, 1147 (1980).
14. Tobey W.: *Electronics* 50, 115 (1977).
15. Wittekiek S.: *Electronics* 50, 32 (1977).
16. Widman D. W., Binder H.: *IEEE Trans. Electron. Devices ED-22*, 407 (1975).
17. Roussel J.: *Solid State Technol.* 21/5, 67 (1978).
18. Wittekoek S.: *Solid State Technol.* 23/6, 80 (1980).
19. O'Toole M. M., Neureuther A. R.: *Develop. in Semicond. Microl. SPIE* 174, 22 (1979).
20. Hershel R.: *J. of SPIE* 135, 48, (1978).
21. Hopkins H. H.: *J. Opt. Soc. Amer.* 47, 508 (1957).
22. Swing R. E., Clay J. R.: *J. Opt. Soc. Amer.* 57, 1180 (1967).
23. Born M., Wolf E.: *Principles of Optics*. Pergamon Press, New York 1970.
24. Thompson L. F., Willson C. G., Bowden M. J.: *Introduction to Microlithography*. ACS Symposium Series 219, ACS, Washington 1983.
25. Blanchard C. H., Burnett C. R., Stoner R. G., Weber R. L.: *Introduction to Modern Physics*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.
26. Goodman J. W.: *Introduction to Fourier Optics*. McGraw-Hill, New York 1968.
27. Berezin G. N., Nikitin A. V., Suris R. A.: *Optičeskije osnovy kontaktnoj fotolitografiji*. Radio i svjaz, Moskva 1982.

28. Levi L., Austing R. H.: *Appl. Opt.* 7, 967 (1968).
29. Bruning J. H.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1925 (1979).
30. Lacombat M., Dubroeuq G. M.: *Proc. SPIE* 174, 28 (1979).
31. Dill F. H.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 440 (1975).
32. Dill F. H.: *IEEE Trans. Electron. Devices* ED-22, 456 (1975).
33. Brewer G. R.: *Electron-Beam Technology in Microelectronic Fabrication*. Academic Press, New York 1980.
34. Walker E. J.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 456 (1975).
35. Rosenbluth A. E., Goodmon D., Lin B. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* B1, 1190 (1983).
36. Scott J. P.: *J. Appl. Phys.* 46, 661 (1975), O'Keefe T. W., Vine J., Handy R. M.: *Solid State Electronics* 12, 841 (1969).
37. Herritage M. B.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1135 (1975).
38. Chang T. H. P., Nixon W. C.: *J. Sci. Instrum.* 44, 230 (1967).
39. Chang T. H. P., Wilson A. D., Speth A. J., Ting C. H.: *Proc. 7th Conf. on Electron and Ion Beam Science and Technol.* 1976/b, 392.
40. Ballantyne J. P.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1257 (1975).
41. Herriott D. I.: *Proc. Tutorial Symp. on Semicond. Technol. Electrochem. Soc.* 82/5, 139 (1982).
42. Herriott D. R., Brewer G. R.: *Electron-Beam Lithography Machines in Electron-Beam Technology and Microelectronic Circuit Fabrication*. Academic Press, New York 1981.
43. Bowden M. J.: *J. Electrochem. Soc.* 128, 1950 (1981).
44. Grivet P.: *Electron Optics*. Pergamon Press, Oxford 1965.
45. Pfeiffer H. C.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 887 (1978).
46. Varnell G. L., Spicer D. F., Habley J. F., Robbins R. R., Carpenter C., Malone J. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 17, 1787 (1980).
47. Herriott D. R., Collier R. J., Alles D. S., Stafford J. W.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 385 (1975).
48. Alles D. S., Ashley F. R., Johnson A. M., Townsend R. L.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1252 (1975).
49. Yourke H. S., Weber E. V.: *Tech. Digest IEDM 1976*, 431.
50. Saunders T. E.: *Solid State Technol.* 25/5, 73 1982.
51. Zacharias A.: *American Vac. Soc. Proceedings: 15th Symposium on Electron, Ion and Photon Beam Technology*, p. 1953, Boston 1979.
52. Neukermans, A. P., Garrettson G. A.: *Hewlett-Packard Journal* 33, 8 (1982).
53. Maydan D., Coquin G. A., Lewinston H. J., Sinha A. K., Wang D. N. K.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1959 (1979).
54. Spears D. L., Smith H. I.: *Solid State Technol.* 15/3, 21 (1972).
55. Rissman P., Watts M. P. C.: *Hewlett-Packard Journal* 32, 12 (1981).
56. Levinstein H.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts* 81/2, 281 (1982).
57. Anonym: *The Rosen Electron. Letter* 1982/2, 7; *Electron. Weekly* 57/28, 12E (1984).
58. Hall T. M., Wagner A., Thompson L. F.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1889 (1979).
59. Seliger R. L., Kubena R. L., Ward J. W., Wang V.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1610 (1979).

60. Stengl G., Kaitna R., Loschner H., Rieder R., Wolf P., Sacher R.: *Solid State Technol.* 25/8, 104 (1982).
61. Lin B. J., Chang T. H. P.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1669 (1979).
62. Hatzakis M., Hofer D., Chang T. H. P.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1631 (1979).
63. Reekstin J., McCoy J.: *Solid State Technol.* 24/8, 68 (1981).
64. Galloway K. F., Mayo S.: *J. Appl. Phys.* 49, 2586 (1978).
65. Ning T. H.: *J. Appl. Phys.* 49, 4077 (1978).
66. Bernacki S. E., Smith H. I.: *IEEE Trans. Electron Devices ED-22*, 421 (1975).
67. Balk P. J.: *J. Electrochem Soc.* 112, 185 C (1965).
68. Brown D. B., Gilfrich J. V., Peckerar M. C.: *J. Appl. Phys.* 46, 4357 (1975).
69. Peckerar M., Fulton R., Blaise P., Brown D., Whitlock R.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1658 (1979).
70. de Forest W. S.: *Photoresist: Materials and Processes*. McGraw-Hill, New York 1975;
Hershel R.: *Proc. SPIE* 135, 24 (1978);
Lacombat M., Massin J., Dubroeuq G. M.: *Solid State Technol.* 23/8, 115 (1980);
Jain K., Willson C. G., Lin B.: *IEEE Electron Devices Lett. EDL-23*, 53 (1982).
71. Gunderson R. C., Hart A. W.: *Synthetic Lubricant*. Reinhold, New York, 1975.
72. Fogiel M.: *Modern Microelectronics*. Research and Education Press, New York 1972.
73. Maissel L. I., Glang R.: *Handbook of Thin Film Technology*. McGraw-Hill, New York 1970.
74. Harper C. A.: *Handbook of Materials and Processes for Electronics*. McGraw-Hill, New York 1970.
75. Burggraaf P. S.: *Semicond. Int.* 4/7, 71 (1981).
76. Kuang B. M., Chang C. B.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 2025 (1980).
77. Flory P. J.: *Principles of Polymer Chemistry*. Cornell University Press, Ithaca 1953.
78. Billmeyer F. W.: *Textbook of Polymer Science*. Wiley, New York 1971.
79. Brandrup J., Immergut E. H.: *Polymer Handbook*. Interscience, New York 1980.
80. Lai J. H.: *Polymer Eng. Sci.* 19, 1117 (1979).
81. Burkman D.: *Semicond. Int.* 4/7, 103 (1981).
82. Washo B. D.: *IBM J. Res. Dev.* 21, 190 (1977).
Flack W. W., Soong D. S., Bell A. T.: *J. Appl. Phys.* 56, 1199 (1984).
83. Damond G. F.: *Proc. Second Kodak Semin. Microminiaturization*. Kodak Publ. P-89, Rochester 1966.
84. Schwartz G. G.: *Proc. Second Kodak Semin. Microminiaturization*. Kodak Publ. P-77, Rochester 1965.
85. Dunham K. R.: *Solid State Technol.* 14/6, 41 (1971).
86. Maláč J., Šimůnková E., Zelinger J.: *J. Polym. Sci.* A7, 1893 (1969).
87. Kletčenkov I. I., Těrechova G. V.: *Poluprovodnikovaja tehnika i mikroelektro- nika* 20, 95 (1975).
88. Peters D. A., Deckert C. A.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 883 (1979).
89. Glang R., Holmwood R., Rosenfeld R.: *Rev. Sci. Indust.* 36, 7 (1965).
90. Calvert J. G., Pitts J. N., Jr.: *Photochemistry*. Wiley, New York 1967.

91. Guillet J. E., Houvenaghel-Defoort B., Kilp N. J., Steimetz H. C., Schuster G.: *Macromolecules* 7, 942 (1974).
92. Amerik Y., Guillet J. E.: *Macromolecules* 4, 375 (1971).
93. Stacy I. F.: *Proc. Kodak Photoresist Semin.* Kodak Publ. P-209, 64 (1969).
94. Goldrick M. R., Plauser L. R.: *Photogr. Sci. Eng.* 17, 386 (1973).
95. Kroll H.: *Proc. IPC Fall Meeting Photoprinting Photoresist* 1968, C-16.
96. Damond G.: *Kodak Photoresist Semin.* Kodak Publ. P-192-B, Vol. II, 47 (1968).
97. Altman J. H.: *Solid State Technol.* 12, 34 (1969).
98. Brunning J. H., Feldman M., Kinsel T. S., Sittig E. K., Townsend R. L.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 487 (1975).
99. Dill F. H., Hornberger W. P., Hauge P. S., Shaw J. M.: *IEEE* 22, 445 (1975).
100. Konnerth K. L., Dill F. H.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 452 (1975).
101. Alberts J., Novotny D.: *Solid State Technol.* 23/6, 1400 (1980).
102. Jerusalemčik I. G., Levin D. M., Krivenko A. F.: *Elektron. Tech. Ser. 2, Poluprov. Pribory* 6, 27 (1975).
103. Ilten D. F., Sutton R. J.: *Solid State Sci. Technol.* 119, 539 (1972).
104. Bokov J. C., Korsakov V. C., Malševa N. S., Goron A. G.: *Elektron. Tech. Ser. 6, 1, 108* (1972).
105. Loprest F. J., Fitzgerald E. A.: *Photogr. Sci. Technol.* 15, 260 (1971).
106. Berning P. H.: *Physics of Thin Films* (Haas G., Edit.). Academic Press, New York 1963.
107. McGillis D. A., Fehrs D. J.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-22, 471 (1975).
108. Reiser A., Pitts E.: *Photogr. Sci. Eng.* 20, 255 (1976).
109. Reiser A.: *Photoresist Seminar*. Polytechnic Institute of New York, Brooklyn, April 1983.
110. Lazár M., Mikulášová D.: *Syntéza a vlastnosti makromolekulových látok*. Alfa, Bratislava 1976.
111. Ueberreiter K.: *Diffusion of Polymers* (Crank J., Edit.). Academic Press, New York 1968.
112. Tu Y. O., Ouano A. C.: *IBM Journal Res. Dev.* 21/2, 131 (1977).
113. Narasimham M. A., Lounsbury J. B.: *SPIE, Semiconductor Microlithography II*, 100, 57 (1977).
114. Kolcov J. I., Kušnarev V. A., Mozžuchin D. D.: *Ž. Nauč. Prikl. Fotogr. Kine-matogr.* 24, 321 (1979).
115. Davidson E. B.: *Tech. Pap., Reg. Tech. Conf. Soc. Plast. Eng.*, Mid-Hudson Sec., October 1970.
116. Leonard R. F., Sim G., Weiss R.: *Solid State Technol.* 24/6, 100 (1981).
117. Burkman D., Johnson A.: *Solid State Technol.* 26/5, 125 (1983).
118. Morgan J. M., Taylor G. N.: *J. Vac. Sci. Technol.* 19, 1127 (1981).
119. Kolf G., Laessing W.: *Polymer Sci. Technol.* 11, 492 (1971).
120. Soutor Z., Šavel J., Žůrek J.: *Hybridní integrované obvody*. SNTL, Praha 1982.
121. Elliott D. J.: *Solid State Technol.* 25/12, 91 (1982).
122. Grigorovič S. L., Nikolskij V. G.: *Ž. Prikl. Chim.* 1975/6, 1307.
123. Gurov S. A., Erlic P. D., Perova T. S., Dinaburg V. A.: *Elektron Tech. Ser. 2, Poluprov. Pribory* 7, 13 (1972).

124. Birkerman J. J.: *Polymer Conference Series*. Wayne State Univ., Wayne, June 1967.
125. Deckert C. A., Peters D. A.: *Print. Circuits Manuf.* 18, 22 (1978).
126. Deckert C. A., Peters D. A.: *Thin Solid Films* 68, 417 (1980).
127. Lee L. H.: *J. Appl. Polym. Sci.* 12, 719 (1968).
128. Cunningham J. A., Sharif L. E., Baira S. S.: *J. Electrochem. Technol.* 1, 7 (1963).
129. Cullen G. W., Amick J. A., Gerlich D.: *J. Electrochem. Soc.* 109, 124 (1962).
130. Blackman L. C. F., Harrop R.: *J. Appl. Chem.* 18, 43 (1968).
131. USA pat. 2 688 006.
132. USA pat. 2 688 007.
133. USA pat. 3 549 368.
134. USA pat. 2 338 839.
135. Maricane J. C., McGibbon R. C.: *J. Electrochem. Soc., Accel. Brief. Comm.* 1982, 2390.
136. Mittal K. L.: *Solid State Technol.* 22/5, 89 (1979).
137. Kaplan L. H., Bergin B. K.: *Solid State Technol.* 23/2, 386 (1980).
138. ČSSR pat. 213 016.
139. Europ. pat. 009 5388.

3.6 LITERATURA

1. Bethe H. A., Ashkin J.: *Experimental Nuclear Physics* (Sergé E., Edit.). Vol. 1. Wiley, New York 1953.
2. Geitler V.: *Kvantovaja teorija izlučenia*. Izdatělstvo inostrannoju litěratyry, Moskva 1956.
3. Makhlis P. A.: *Radiation Physics and Chemistry of Polymers*. Wiley, New York 1975.
4. Katz L., Peufald A. S.: *Rev. Mod. Phys.* 24, 28 (1952).
5. Spinks P., Woods P.: *Introduction to Radiation Chemistry*. Wiley, New York 1964.
6. Partridge R. H.: *The Radiation Chemistry of Macromolecules* (Dole M., Edit.). Vol. 1. Academic Press, New York 1973.
7. Hirsch J., Martin E.: *Solid State Commun.* 7, 279 (1969).
8. Hirsch J., Martin E.: *Solid State Commun.* 7, 783 (1969).
9. Hirsch J., Martin E.: *J. Non-Cryst. Solids* 4, 133 (1970).
10. Yahai K., Shinohara K.: *J. Appl. Phys.* 37, 310 (1966).
11. Ovčnikov A. A.: *Ž. Strukt. Chim.* 6, 291 (1965).
12. Frankevič Je. L.: *Usp. Chim.* 35, 1161 (1966).
13. Dexter D. L.: *J. Chem. Phys.* 21, 836 (1953).
14. Inokuti M., Hirayama F.: *J. Chem. Phys.* 43, 1978 (1965).
15. Birks J. B.: *Nature (London)* 214, 1187 (1967).
16. Birks J. B., Dysom D. J., Munro I. H.: *Proc. Roy. Soc.* A275, 575 (1963).
17. Birks J. B.: *Progress in Reaction Kinetics* (Porter G., Edit.). Vol. 5. Pergamon Press, Oxford 1970.

18. Förster Th.: *Discuss. Faraday. Soc.* 27, 7 (1959).
19. Förster Th.: *Rad. Res. Suppl.* 2, 326 (1960).
20. Förster Th.: *Comparative Effects of Radiation* (Burton M., Kirby-Smith I. S., Magee J. L., Edits.). Wiley, New York 1960.
21. Förster Th.: *Modern Quantum Chemistry. Istanbul Lectures* (Sinanogen O., Edit.). Vol. 3. Academic Press, New York 1966.
22. Förster Th.: *Energetics and Mechanism in Radiation Biology* (Philips G. O., Edit.). Academic Press, New York 1968.
23. Kasha M.: *Physical Processes in Radiation Biology* (Augeustein, L. G., Mason R., Rosenberg B., Edits.). Academic Press, New York 1964.
24. Kasha M.: *Rev. Mod. Phys.* 31, 162 (1959).
25. Platzman R. L.: *Radiat. Res.* 17, 419 (1962).
26. Charlesby A., Patridge R. H.: *Proc. Roy. Soc.* A283, 329 (1965).
27. Partridge R. H.: *J. Chem. Phys.* 52, 2491 (1970).
28. Golden S.: *Quantum-Statistical Foundations of Chemical Kinetics.* Oxford University Press, London 1968.
29. Peterson N. L.: *Solid State Phys.* 22, 409 (1968).
30. Waite T. R.: *Phys. Rev.* 107, 463 (1957).
31. Waite T. R.: *J. Chem. Phys.* 28, 103 (1958).
32. Waite T. R.: *J. Chem. Phys.* 32, 21 (1960).
33. Noyers R. M.: *Progress in Reaction Kinetics* (Porter G., Edit.). Vol. 1. Pergamon Press, Oxford 1961.
34. Kliwer K. L., Ksoehler J. S.: *Phys. Rev.* 140, A1226 (1965).
35. Burton J. J.: *Phys. Rev.* 177, 1346 (1969).
36. Hedvig P.: *The Radiation Chemistry of Macromolecules* (Dole M., Edit.). Vol. 1. Academic Press, New York 1972.
37. Golub M. A.: *J. Phys. Chem.* 69, 2639 (1965).
38. Golub M. A., Danon J.: *Can. J. Chem.* 43, 2772 (1965).
39. Golub M. A., Stephens C. L.: *J. Polym. Sci.* B4, 959 (1966).
40. Golub M. A.: *Radiation Research* (Silini G., Edit.). North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1967.
41. Böhm G. G. A.: *J. Polym. Sci. B* 14, 437 (1976).
42. Von Raven A., Heusinger H., *J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.* 12, 2255 (1974).
43. Angelo R. J., Ikeda R. M., Wallach I. L.: *Polymer* 6, 141 (1965).
44. Zott H., Heusinger H.: *Macromolecules* 8, 182 (1975).
45. Zott H., Heusinger H.: *J. Phys. Chem.* 79, 711 (1975).
46. Nivikov G. F., Kozlov V. T., Jakovlev E. E., Frankevič Je. L.: *Chim. Vys. Energ.* 4, 337 (1970).
47. Frankevič Je. L., Jakovlev B. S., *Ž. Fiz. Chim.* 37, 1106 (1963).
48. Jakovlev B. S., Frankevič Je. L.: *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Chim.* 1966, 402.
49. Kozlov V. T., Tarassova Z. N.: *Vysokomol. Sojedin.* 8, 943 (1966).
50. Kozlov V. T.: *Vysokomol. Sojedin.* A9, 515 (1967).
51. Fox R. B., Price T. R.: *J. Appl. Polym. Sci.* 11, 2373 (1967).
52. Bagdasarian K. S., Kronganz V. A., Kardaš N. S.: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 144, 101 (1962).

53. Milutinskaja R. I., Bagdasarian K. S.: *Ž. Fiz. Chim.* 38, 776 (1964).
54. Brovkova L. J., Bagdasarian K. S.: *Chim. Vys. Energ.* 1, 340 (1967).
55. Gardner D. G., Epstein L. M.: *J. Chem. Phys.* 34, 1653 (1961).
56. Gardner D. G., Henry G., Ward D.: *Energy Transfer in Radiation Processes* (Phillips G. O., Edit.). Elsevier, Amsterdam 1966.
57. Wilske J., Heusinger H.: *Radiochim. Acta* 11, 187 (1969).
58. Ho S. K., Siegal S.: *J. Chem. Phys.* 50, 1142 (1969).
59. Campbell D.: *Macromol. Rev.* 4, 91 (1970).
60. Kircher J. F., Sliemers F. A., Markle R. A., Gager W. B., Leininger R. I.: *J. Phys. Chem.* 69, 189 (1965).
61. Kouřim P., Vacek K.: *Trans. Faraday Soc.* 61, 415 (1964).
62. Symons M. C. R.: *J. Chem. Soc.* 1959, 277.
63. Symons M. C. R.: *J. Chem. Soc.* 1963, 1186.
64. Sohma J., Komatsu T., Kashiwabara H.: *J. Polym. Sci.* B3, 287 (1965).
65. Schultz A. R.: *J. Polym. Sci.* 35, 369 (1959).
66. Chapiro A.: *Radiation Chemistry of Polymeric Systems*. Wiley, New York 1962.
67. Todd A.: *J. Polym. Sci.* 42, 223 (1960).
68. Hiraoka H.: *IBM J. Res. Develop.* 21, 121 (1977).
69. Helbert J. N., Chen C.-Y., Pittman C. V., Hagnauer G. L.: *Macromolecules* 11, 104 (1978).
70. Hirsch J., Martin E.: *J. Noncrystallgr. Solids* 4, 133 (1970).
71. Partridge R. H.: *J. Chem. Phys.* 52, 2941 (1970).
72. Partridge R. H.: *J. Chem. Phys.* 52, 2501 (1970).
73. Tomma S. Z., Hamill A. W.: *J. Amer. Chem. Soc.* 86, 1487 (1974).
74. Dole M.: *Advances in Radiation Chem. Vol. 4*, Wiley, New York 1974.
75. Chapiro A.: *Radiation of Polymeric Systems*. Wiley, New York 1962.
76. Turner D. T.: *J. Polym. Sci.* A2, 1699 (1964).
77. Bowmer T. N., O'Donnell J. H., Wells P. R.: *Macromol. Chem., Rapid. Commun.* 1, 1 (1980).
78. Bowmer T. N., O'Donnell J. H., Wells P. R.: *Polymer Bulletin* 2, 103 (1980).
79. Bowmer T. N., O'Donnell J. H.: *J. Polym. Sci.* A19, 45 (1981).
80. Bowmer T. N., O'Donnell J. H.: *J. Macromol. Sci. Chem.* A17, 243 (1982).
81. Bowmer T. N., Bowden M. J.: *Org. Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 171 (1983).
82. Bowden M. J., Allara D. L., Vroom W. I., Frackowiak J., Kelley L. C., Falcone D. R.: *Org. Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 161 (1983).
83. Harrah L. A.: *Mol. Crystal. Liquid Crystalogr.* 9, 197 (1969).
84. Wilske J., Heusinger H.: *J. Polym. Sci.* A1, 995 (1969).
85. Heusinger H., Rosenberg A.: *Symposium on Large Radiation Sources for Industrial Processes* (Beck E. R. A., Edit.). IAEA Publ., Vienna 1969.
86. Burlant W., Nurman J., Serment V.: *J. Polym. Sci.* 58, 491 (1962).
87. Charlesby A.: *Proc. Roy. Soc.* A215, 187 (1952).
88. Dole M.: *Report of Symposium IV—Chemistry and Physics of Radiation Dosimetry*. Arma Chemical Center, Maryland 1950.
89. Matsuo H., Dole M.: *J. Phys. Chem.* 63, 837 (1959).
90. Böhm G. G. A.: *J. Polym. Sci.* A2, 639 (1967).

91. Ohnishi S. I., Sugimoto S. I., Nitta I.: *J. Polym. Sci. A1*, 605 (1963).
92. Neudörfl P.: *Kolloid-Z. Z. Polym.* 224, 25 (1968).
93. Dušek K., Prins W.: *Adv. Polym. Sci.* 6, 1 (1969).
94. Flory P. J.: *J. Amer. Chem. Soc.* 63, 3083 (1941).
95. Flory P. J.: *J. Amer. Chem. Soc.* 63, 3091 (1941).
96. Flory P. J.: *J. Amer. Chem. Soc.* 63, 3096 (1941).
97. Flory P. J.: *J. Phys. Chem.* 46, 132 (1942).
98. Stockmayer W. H.: *J. Phys. Chem.* 11, 45 (1943).
99. Stockmayer W. H.: *J. Phys. Chem.* 12, 125 (1942).
100. Charlesby A.: *J. Polym. Sci.* 11, 513 (1953).
101. Charlesby A.: *Proc. Roy. Soc. A222*, 60 (1954).
102. Charlesby A.: *Proc. Roy. Soc. A222*, 542 (1954).
103. Charlesby A.: *Proc. Roy. Soc. A224*, 120 (1954).
104. Charlesby A.: *Proc. Roy. Soc. A231*, 521 (1955).
105. Saito O.: *J. Phys. Soc. Japan* 13, 198 (1958).
106. Good I. J.: *Proc. Roy. Soc. A272*, 54 (1963).
107. Gordon M., Malcolm G. N.: *Proc. Roy. Soc. A295*, 29 (1966).
108. Gordon M., Scantlebury G. R.: *J. Polym. Sci. C16*, 3933 (1968).
109. Dobson G. R., Gordon M.: *J. Chem. Phys.* 43, 405 (1965).
110. Gordon M., Ross-Murphy S. B.: *Pure Appl. Chem.* 43, 1 (1975).
111. Inokuti M.: *J. Chem. Phys.* 38, 1174 (1963).
112. Schulz G. V.: *Z. Phys. Chem. B43*, 25 (1939).
113. Schulz G. V.: *Z. Phys. Chem. B44*, 227 (1939).
114. Zimm B. H., Stockmayer W. H.: *J. Chem. Phys.* 17, 1301 (1949).
115. Inokuti M., Katsuura K.: *J. Phys. Soc. Japan* 14, 1379 (1959).
116. Saito O.: *J. Phys. Soc. Japan* 13, 198 (1958).
117. Charlesby A., Pinner S. H.: *Proc. Roy. Soc. A249*, 367 (1959).
118. Inokuti M., Dole M.: *J. Chem. Phys.* 38, 3006 (1963).
119. Squire D. R., Turner D. T.: *Macromolecules* 5, 401 (1972).
120. Sobolev V. S., Klauzen N. A., Zajdec A. L.: *Koloid. Ž.* 32, 752 (1970).
121. Lyons B. J.: *J. Polym. Sci. A3*, 777 (1965).
122. Scott K. W.: *J. Polym. Sci.* 58, 517 (1962).
123. Inokuti M.: *J. Chem. Phys.* 38, 2999 (1963).
124. Pearson D. S., Skutnik B. J., Böhm G. G. A.: *J. Polym. Sci. B12*, 925 (1974).
125. With E.: *J. Polym. Sci.* 41, 507 (1959).
126. Tamigaki K., Ohnishi Y., Fujiwara S.: *Org. Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 179 (1983).
127. Ohnishi Y., Tanigaki K., Furuta A.: *Org. Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 194 (1983).
128. Helbert J. N., Poindexter E. H., Pittman C. V.: *Polym. Eng. Sci.* 20, 630 (1980).
129. Böhm G. G. A.: *The Radiation Chemistry of Macromolecules.* (Dole M., Edit.). Vol. 2. Academic Press, New York 1973.
130. Parkinson W. W., Sears W. C.: *Advan. Chem. Ser* 66, 57 (1967).

131. Blachford J., Robertson R. F.: *J. Polym. Sci.* *A3*, 1313 (1965).
132. Thompson E. V.: *Polym. Lett.* *3*, 675 (1965).
133. Kusy R. P., Turner D. T.: *Macromolecules* *4*, 337 (1971).
134. Kusy R. P., Turner D. T.: *J. Polym. Sci.* *10*, 1745 (1972).
135. Kusy R. P., Turner D. T.: *J. Polym. Sci.* *8*, 235 (1975).
136. Kusy R. P., Turher D. T.: *J. Polym. Sci.* *10*, 493 (1977).

4.6 LITERATURA

1. Hawryluk R. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 18/1, 1 (1981).
2. Nosker R. W.: *J. Appl. Phys.* 40, 1872 (1969).
3. Hawryluk A. M., Hawryluk R. J., Smith H. I.: *J. Appl. Phys.* 45, 2551 (1974).
4. Kyser D., Viswanathan N. S.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1305 (1975).
5. Greeneich J. S., Van Duzer T.: *IEEE Trans. Electron. Devices ED-21*, 286 (1974).
6. Heidenreich R. D.: *J. Appl. Phys.* 48, 1418 (1977).
7. Everhart T. E. J.: *Appl. Phys.* 31, 1483 (1960).
8. Chung M. S. C., Tai K. L.: *Proc. 8th Intl. Conf. on Electron and Ion Beam Sci. and Technol* (Bakish R., Edit.). Electrochemical Soc., Washington 1978.
9. Heidenreich R. D., Thompson L. F., Feit F. D., Melliar-Smith C. M.: *J. Appl. Phys.* 44, 4039 (1973).
10. Heidenreich R. D. Ballantyne, J. P., Thompson L. F.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1284 (1975).
11. Everhart T. E., Hoff P. H.: *J. Appl. Phys.* 42, 5837 (1971).
12. Ku H. Y., Scala L. C. J.: *J. Electrochem. Soc.* 116, 980 (1969).
13. Greeneich J. S.: *J. Electrochem. Soc.* 122, 970 (1975).
14. Wolf E. D., Ozdemir F. S., Perkins W. E., Coane P. J.: *Proc. 11th Symp. on Electron, Ion and Laser Beam Technol* (Thomley R. F., Edit.). San Francisco Press, San Francisco 1971.
15. Hatzakis M.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1276 (1975).
16. Pittman C. U., Igbal M., Chen C. Y., Helbert J. N.: *J. Polym. Sci.* 16A, 2721 (1978).
17. Bednář B., Devátý J., Králíček J., Zachoval J.: *Org. Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 706 (1983).
18. Bowden M. J.: *J. Polymer Sci. Polym. Symp.* 49, 221 (1974).
19. Bowden M. J., Thompson L. F.: *J. Appl. Polym. Sci.* 17, 3211 (1973).
20. Greeneich J. S.: *J. Appl. Phys.* 45, 5264 (1974).
21. Greeneich J. S.: *J. Electrochem. Soc.* 121, 1669 (1974).
22. Kohnerth K. L., Dill F. M.: *IEEE Trans. Electron. Devices ED-22*, 452 (1979).
23. Tu Y.: *Quart. Appl. Mathematics* 35, 269 (1977).
24. Tu Y., Ouano A. C.: *IBM. J. Res. Develop.* 21, 131 (1977).
25. Ballantyne J. P.: *J. Vac. Sci. Technol.* 22, 2261 (1975).
26. Weiss A.: *Semicond. Int.* 5, 65 (1982).
27. Bowden M. J.: *Solid. State Technol.* 24/5, 73 (1981).
28. Tamamura T., Imamura S., Sugawara S.: *Org. Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 150 (1983).
29. Thornley R. F. M., Sun T. J.: *J. Electrochem. Soc.* 112, 1151 (1965).
30. Matta R. K.: *Electrochem. Technol.* 5, 382 (1963).
31. Seiti D.: *Denki Sikense Icho* 31, 557 (1967).
32. Broers A. N.: *Microelectron. Real.* 4, 103 (1965).
33. Paal T., Strähle V. D., Kilhorn G.: *J. Electrochem. Soc.* 120, 1714 (1973).
34. Koichi K.: *Bull Electrotechn. Lab. (Japan)* 33, 981 (1969).
35. Perkins K. D., Bennett R.: *Kodak Fotoresist Seminar Proc.* 2, 39 (1968).

36. Miyauchi S.: *Solid State Technol.* 13, 56 (1970).
37. Miyauchi S.: *Solid State Technol.* 13, 43 (1970).
38. Bowden M. J., Thompson L. F.: *Reg. Tech. Conf., Soc. Plast. Eng., "Photopolymers"*, Neville, New York 1973.
39. Larkin M. W., Matta R. K.: *Solid State Electron.* 10, 491 (1967).
40. Seiti D.: *Denki Gidznen* 9, 69 (1972).
41. Omerod M. G., Charlesby A.: *Polymer* 4, 459 (1963).
42. Roberts E. D.: *J. Electrochem. Soc.* 120, 1716 (1973).
43. Hatzakis M.: *Proc. Microcircuit Engineering*, Lausanne 1981.
44. Yatsui Y., Nakata K., Umehara K.: *J. Electrochem. Soc.* 116, 94 (1969).
45. USA pat. 4 237 208.
46. SSSR pat. 701 324.
47. USA pat. 3 825 428.
48. Cole H. S., Skelly D. W., Wagner B. C.: *IEEE Trans. Electron Devices ED-22*, 417 (1975).
49. USA pat. 3 703 402.
50. Bartelt J. L.: *Appl. Polym. Symp.* 23, 139 (1974).
51. Hatzakis M.: *Polym. Eng. Sci.* 14, 516 (1974).
52. Brewer T. L.: *Polym. Eng. Sci.* 14, 534 (1974).
53. NSR pat. 2 706 878. Hirai T., Hatano Y., Nonogaki S.: *J. Electrochem. Soc.* 118, 669 (1971).
54. Wilsson C. G.: *Introduction to Microlithography* (Thompson L. F., Wilsson C. G., Bowden M. J., Edits.). *ACS Symp. Series 219*, ACS, Washington 1983.
55. USA pat. 3 885 060.
56. Nonogaki S., Morishito H., Saiton N.: *Appl. Polym. Symp.* 23, 117 (1974).
57. Feit E. D., Heidenreich R. D.: Thompson L. F.: *Appl. Polym. Symp.* 23, 125 (1974).
58. Bartelt J. L., Feith E. D.: *J. Electrochem. Soc.* 122, 341 (1975).
59. Thompson L. F., Feith E. D., Heidenreich R. D.: *Polym. Eng. Sci.* 14, 529 (1974).
60. Thompson L. F.: *Solid State Technol.* 17, 27 (1974).
61. Thompson L. F., Ballantyne J. P., Feit E. D.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1280 (1975).
62. Ballantyne J. P.: *J. Vac. Sci. Technol.*, 12, 1257 (1975).
63. Pease R. F. W., Ballantyne J. P., Henderson R. C., Voschenkov A. M., Yau L. D.: *IEEE Trans. Electron. Devices ED-22*, 393 (1975).
64. Henderson R. C., Voschenkov A. M., Mahoney G. E.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1261 (1975).
65. NSR pat. 2 543 553.
66. USA pat. 4 279 986.
67. Bednář B., Chuchma F., Zajíc S., Kálal J., Králíček J.: *Scientific Papers of Prague Institute of Chemical Technology S7*, 255 (1982).
68. Bednář B., Devátý J., Králíček J., Zachoval J.: *Organics Coatings and Appl. Polym. Sci.* 48, 706 (1983).
69. Thompson L. F., Stillwagon L. E., Doerries E. M.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 983 (1978).

70. Taylor G. N., Coquin G. A., Somekh S.: *Polym. Eng. Sci.* 17, 420 (1977).
71. Thompson L. F., Doerries E. M.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 1699 (1979).
72. Thompson L. F., Yau L., Doerries E. M.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 1703 (1979).
73. Feit E. D., Thompson L. F., Wilkins C. W., Wurtz M. E., Doerries M., Stillwagon L. E.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1997 (1979).
74. USA pat. 4 130 424.
75. EP pat. 0 005 551.
76. USA pat. 4 208 211.
77. Taniguchi Y., Hatano Y., Shirashi H., Hirogome S., Nonogaki S., Naraoka K.: *Japan. J. Appl. Phys.* 18, 1143 (1979).
78. USA pat. 3 916 035.
79. Franc. pat. 2 250 138.
80. USA pat. 4 315 067.
81. Parkinson W. W., Keyser R. M.: *The Radiation Chemistry of Macromolecules* (Dole M., Edit.). Vol. 2. Academic Press, New York 1973.
82. Lai J. H., Shepherd T.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 696 (1979).
83. Imamura S., Sugawars S.: *Proc. 15th Symposium on Semiconductors and Integrated Circuits Technology*. Tokyo 1978.
84. Imamura S.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 1628 (1979).
85. Feit E. D., Stillwagen L. E.: *Polym. Eng. Sci.* 20, 1059 (1980).
86. Imamura S., Sugawara S., Tamamura T.: *Appl. Polym. Sci.* 27, 937, (1982).
87. Shiraishi H.: *Polym. Eng. Sci.* 20, 1054 (1980).
88. Sukeewa K., Sugawara S.: *Japan J. Appl. Phys.* 20, 1583 (1981).
89. Choong H. S., Kahn F. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 19, 1121 (1981). Tanigaki K., Ohnishi Y., Fujiwara S.: *Polymers in Electronics. ACS Symposium Series 242*, Washington 1984.
90. Ohniski Y.: *J. Vac. Sci. Technol.* 19, 1136 (1981).
91. USA pat. 4 201 580.
92. Hofer D. C., Kaufman F., Kramer S.: *Proc. Regional Tech. Conf. Photopolymers, Principles, Processes and Materials, Midhudson Section. SPE*, Ellenville 1979.
93. Kaufman F. B., Hofer D. C., Kramer S. R.: *Org. Coatings and Plastics Chem.* 43, 375 (1980).
94. Hofer D. C., Kaufman F., Kramer S.: *Appl. Phys. Lett.* 37, 314 (1980).
95. Franc. pat. 2 168 593.
96. USA pat. 4 252 886.
97. USA pat. 4 121 936.
98. USA pat. 3 940 507.
99. USA pat. 4 273 858.
100. USA pat. 4 439 647.
101. Haller I., Hatzakis M., Srinivasan R.: *IMB J. Res. Develop.* 12, 251 (1968).
102. Hatzakis M.: *J. Electrochem. Soc.* 116, 1033 (1969).
103. Ku H. V., Scaln L. C.: *J. Electrochem. Soc.* 116, 980 (1969).
104. Herzog R., Greeneich J., Everhart T., Van Duzer T.: *IEEE Trans. Electron Devices ED-19*, 635 (1972).
105. Harris R. A.: *J. Electrochem. Soc.* 120, 270 (1973).

106. Hatzakis M.: Appl. Polym. Symp. 23, 73 (1974).
107. Gipstein E., Ouano A. C., Johnson D. E., Need O. U.: IBM J. Res. Develop. 21, 143 (1977).
108. Zeitler H. U., Hieke E. K.: J. Electrochem. Soc. 126, 1430 (1979).
109. Franc. pat. 2 394 833.
110. USA pat. 3 996 393.
111. USA pat. 3 931 435.
112. USA pat. 3 535 137.
113. USA pat. 3 984 582.
114. USA pat. 4 024 293.
115. USA pat. 4 074 031.
116. NSR pat. 3 024 522.
117. EP pat. 0 008 787.
118. Gipstein E., Moreau W., Need O.: J. Electrochem. Soc. 123, 1106 (1976).
119. Levine A. W., Kaplan M., Poliniak E. S.: Polym. Eng. Sci. 14, 518 (1974).
120. NSR pat. 2 628 467.
121. USA pat. 4 243 742.
122. NSR pat. 2 757 932.
123. NSR pat. 2 757 931.
124. NSR pat. 2 609 218.
125. NSR pat. 2 642 269.
126. USA pat. 4 156 745.
127. USA pat. 4 125 672.
128. Sumi M., Ninomiya M., Chiba F., Nakasuji M., Sano S., Takeishi Y.: *Technical Papers of Intern. Conf. on Microlithography*. Paris 1977, p. 81.
129. Murase K., Kakuchi M., Sugawara S.: *Technical Papers of Intern. Conf. on Microlithography*. Paris 1977.
130. Katuchi M., Murase K., Sugawa S.: J. Electrochem. Soc. 124, 1648 (1977), p. 261.
131. Bednář B., Devátý J., Králíček J., Zachoval J.: Org. Coatings and Appl. Polym. Sci. 48, 711 (1983).
132. USA pat. 3 964 908.
133. Helbert J. H., Cook C. F., Chen C.-Y., Pittman C. U.: J. Electrochem. Soc. 126, 694 (1979).
134. Lai J. H., Helbert J. N., Cook C. F., Pittman C. U.: J. Vac. Sci. Technol. 16, 1992 (1979).
135. Tada T.: J. Electrochem. Soc. 126, 1829 (1979).
136. Pittman C. U., Veda M., Chen. C. Y., Kwiatkovski J. H., Cook C. F., Helbert J. N.: J. Electrochem. Soc. 128, 1758 (1981).
137. Franc. pat. 2 250 200.
138. USA pat. 4 289 842.
139. USA pat. 4 011 351.
140. USA pat. 4 279 984.
141. NSR pat. 2 602 825.
142. USA pat. 4 133 907.

143. NSR pat. 2 702 427.
144. EP 0 049 884.
145. Roberts E. D.: Appl. Polym. Symp. 23, 87 (1974).
146. USA pat. 4 276 365.
147. USA pat. 4 345 020.
148. USA pat. 4 061 832.
149. Hatzakis M., Johnson D., Merritt D., Moreau W., Moyer W., Pederson L.: J. Vac. Sci. Technol. 16, 1989 (1979).
150. Moreau W., Merritt D., Mayer W., Hatzakis M., Johnson D., Pederson L.: J. Vac. Sci. Technol. 16, 1989 (1979).
151. Hatzakis M.: J. Vac. Sci. Technol. 16, 1984 (1979).
152. Miura A., Hideyama S.: J. Vac. Sci. Technol. 16, 1996 (1979).
153. Tada T.: J. Electrochem Soc. 126, 1635 (1979).
154. Franc. pat. 2 498 198.
155. USA pat. 4 278 754.
156. USA pat. 3 916 036.
157. NSR pat. 2 536 300.
158. Thompson L. F., Bowden M. J.: J. Electrochem. Soc. 120, 1722 (1973).
159. Bowden M. J., Thompson L. F.: J. Electrochem Soc. 121, 1620 (1974).
160. Bowden M. J., Thompson L. F.: Polym. Eng. Sci. 14, 525 (1974).
161. Bowden M. J., Thompson L. F.: J. Appl. Polym. Sci. 17, 3211 (1978).
162. Gipstein E., Moreau W., Chin G., Need O. V.: J. Appl. Polym. Sci. 21, 677 (1977).
163. Gritter R. J., Seeger M., Gipstein E.: J. Polym. Sci. A16, 353 (1978).
164. Yamazaki T., Watakate Y., Suzuki Y., Nakata H.: J. Electrochem Soc. 127, 1859 (1980).
165. Bowden M. J., Thompson L. F., Balantyne J. P.: J. Vac. Sci. Technol. 12, 1294 (1975).
166. USA pat. 3 935 331.
167. USA pat. 3 935 332.
168. Bowden M. J., Thompson L. F., Farenholtz S. R., Doerries E. M.: J. Electrochem. Soc. 128, 1304 (1981).
169. USA pat. 4 153 741.
170. USA pat. 3 898 350.
171. USA pat. 4 355 094.
172. USA pat. 3 961 099.
173. Moran J. M., Taylor G. N.: J. Vac. Sci. Technol. 19, 1127 (1981).
174. USA pat. 4 018 937.
175. USA pat. 3 779 778.
176. USA pat. 3 915 704.
177. USA pat. 3 915 706.
178. USA pat. 3 917 483.
179. USA pat. 3 932 514.
180. NSR pat. 2 610 842.
181. USA pat. 4 311 782.

182. USA pat. 4 311 782.
183. USA pat. 4 005 437.
184. Brit. pat. 1 585 299.
185. USA pat. 5 338 392.
186. USA pat. 4 312 935.
187. USA pat. 4 312 936.
188. NSR pat. 2 520 147.
189. Webb D. J., Hatzakis M.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 2008 (1979).
190. Haller I., Feder R., Hatzakis M., Spiller E.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 154 (1979).
191. USA pat. 4 061 829.
192. USA pat. 4 225 664.
193. USA pat. 4 061 829.
194. USA pat. 3 892 973.
195. EP patent 0 016 679.
196. Franc. pat. 2 461 967.
197. USA pat. 4 330 671.
198. Sinclair W. R., Rousseau D. L., Stancavish J. J.: *J. Electrochem. Soc.* 121, 925 (1974).
199. Kammlott G. W., Sinclair W. R.: *J. Electrochem. Soc.* 121, 929 (1974).
200. Nagai H., Voshikawa A., Togoshima Y., Ochi O., Mizushinara Y.: *Appl. Phys. Lett.* 28, 145 (1976).
201. Yoshikawa A., Ochi G., Nagai H., Mizushima Y.: *Appl. Phys. Lett.* 31, 167 (1977).
202. Yoshikawa A., Ochi O., Nagai H., Mizushima Y.: *Appl. Phys. Lett.* 29, 667 (1976).
203. Tai K. L., Johnson L. F., Murphy D. W., Chung M. S. C.: *Preprints of 155th Electrochemical Soc. Spring Meeting.* Electrochem. Soc., Boston 1969.
204. Tai K. L., Sinclair W. R., Vadimsky R. G., Moran J. M., Rand M. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 16, 1977 (1979).
205. Chang M. S., Chen J. T.: *Appl. Phys. Lett.* 33, 892 (1978).
206. Chang M. S., Hon T. W.: *Thin Solid Films* 55, 463 (1978).
207. Chang M. S.: *Proc. IEEE 3rd Biennial University (Industry) Government Microelectronics Symp.*, Texas Tech. University, Dallas, 1979.
208. Shimizu I., Sakuma H., Kokado H., Inone E.: *Photogr. Sci. Eng.* 16, 291 (1972).
209. Shirakawa T., Shimizu I., Kokado H., Inone E.: *Photogr. Sci. Eng.* 19, 139 (1975).
210. Brit. pat. 1 580 170.
211. Anderson L. C., Roedel M. J.: *J. Amer. Chem. Soc.* 67, 995 (1945).
212. Volodanskij I. L., Belov B. I., Kozlov V. V.: *Ž. Obšč. Chim.* 35, 2071 (1965).
213. Kazicina L. A., Tchat N. D., Volodanskij I. L.: *Ž. Obšč. Prikl. Chim.* 7, 1017 (1971).
214. Hacker N. P., Turrov N. J.: *Tetrahedron Lett.* 23, 1771 (1982).
Willson C. G., Miller R. D., McKean D. R., Clecak N., Tompkins T., Hofer D.: *Polymer Eng. Sci.* 23, 1004 (1983).
215. Kalibabčuk V. A., Didkovskij V. Je.: *Ž. Fiz. Chim.* 55, 2161 (1981).

216. Kalibabčuk V. A., Didkovskij V. Je., Kalibabčuk N. N.: *Ž. Fiz. Chim.* 50, 1457 (1976).
217. Pacansky J., Johnson D.: *J. Electrochem. Soc.* 124, 862 (1977).
218. Pacansky J., Lyerla J. R.: *IBM J. Res. Develop.* 23, 42 (1979).
219. Bobčar D. A., Gambarjan N. I., Miščenko V. V., Kazicina L. A.: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 175, 829 (1967).
220. Fadiman Z. I., Levin Je. S., Chmelnickaja Je. J.: *Elektrochimija* 8, 1437 (1972).
221. Didkovskij V. Je., Kalibabčuk N. N., Kalibabčuk V. A.: *Ž. Obšč. Chím.* 44, 679 (1974).
222. Kazicina L. A., Kljueba N. D., Atnadze L. D.: *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 180, 353 (1968).
223. Kalibabčuk N. N., Didkovskij V. Je., Kalibabčuk V. A.: *Ukr. Chim. Ž.* 5, 476 (1976).
224. Meier H., Zeller K. P.: *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* 14, 32 (1979).
225. Dinaburg M. S.: *Svetočuvstvitelnyje diazosojedinjenja i ich primenenije*. Chimija, Moskva 1964.
226. Yates P., Robb E. W.: *J. Amer. Chem. Soc.* 79, 5760 (1979).
227. Clinging R., Dean F. M., Mitchell G.: *Tetrahedron* 30, 4067 (1974).
228. Ried W., Mengler H.: *Fortschr. Chem. Forsch.* 5, 1 (1965).
229. Smith P. A., Berry W. L.: *J. Org. Chem.* 26, 27 (1961).
230. Sacharova N. A., Rodionova G. N., Erlich R. D.: *Ž. Vses. Chim. Obšč. im. Mendelejeva* 20, 593 (1975).
231. Paramonov A. I., Prochockij I. N., Erlich R. D.: *Ž. Nauč. Prikl. Fotogr. Kine-matogr.* 19, 127 (1974).
232. Ponomareva R. P., Komagorov A. M., Andronova N. A.: *Ž. Obšč. Prikl. Chim.* 16, 146 (1980).
233. Lowe G., Parker J.: *Chem. Commun.* 1971, 1135.
234. Komagorov A. M., Ponomareva R. P.: *Ž. Obšč. Prikl. Chim.* 12, 1728 (1976).
235. Řehák V., Poskočil J., Dvořáček I.: *Coll. Czechoslov. Chem. Commun.* 44, 756 (1979).
236. Böttcher H., Marx J., Lukas J., Strehmel B.: *Z. Chem.* 324, 237 (1982).
Babie W. T., Chow M. F., Moreau W. M.: *ACS Symp. Series* 242, 41 (1984).
237. Orlov F. I., Kalibabčuk N. N., Nikančikova Je. A.: *Sposoby zapisi informacii na bezserebrjannyh nositeljach* 1974/4, 70.
238. Martyčenko A. P., Korsakov V. S., Žuravlev G. I., Nikolskij V. G.: *Ž. Fiz. Chim.* 48, 1826 (1974).
239. Bokov J. S.: *Elektron. Techn.* 1972, ser. 6/1, 108.
240. Řehák V., Poskočil J., Dvořáček I.: *Coll. Czech. Chem. Commun.* 44, 1772 (1979).
241. Erlich E. D., Procenko N. P., Kurkovskaja L. N., Rodionova L. N.: *Ž. Vses. Chim. Obšč.* 20, 593 (1975).
242. Rodionova G. N., Tučin J. G., Procenko N. P., Erlich R. D.: *Ž. Vses. Chim. Obšč.* 20, 593 (1975).
243. Pacansky J., Coufal H.: *J. Amer. Chem. Soc.* 102, 410 (1980).
244. Meier G., Reisenauer H. P., Sayrac T.: *Ber.* 115, 2192 (1982).

245. Zeller K. P.: Chem. Commun. 1975, 317.
246. Böttcher H., Werner R., Becker G. O. H.: Z. Chem. 13/10, 374 (1973).
247. Stankoff T. A., Trozzolo A. M.: Photogr. Sci. Eng. 19, 173 (1975).
248. Trozzolo A. M.: Account. Chem. Res. 1968, 329.
249. Kolcov J. I., Žuravlev G. I.: Zavod. Lab. 42, 408 (1976).
250. Grigorovič S. L., Nikolskij V. G.: Ž. Prikl. Chim. 1975/6, 1307.
251. Pampalone T. R.: Solid State Technol. 27/6, 115 (1984).
252. Treušnikov V. M., Zelenova V. V., Maximova L. I., Kostrova O. S.: Ž. Nauč. Prikl. Fotogr. i Chim. 27, 278 (1982). Dinaburg V. A., Jeruzalimčuk I. G., Zelova V. S., Krejman R. I., Krivenko A. F., Motaleva N. V., Silajeva T. M., Tipajeva V. A., Trachtenberg A. D., Chochlov A. V.: Electron. Techn. 1972, ser. 2/7, 17.
253. Martyčenko A. P., Strižkov B. V.: Electron. Techn., Ser. Materials 1972/2, 82.
254. Skačkov B. K., Solomenko G. V., Kolcov J. I.: Ž. Nauč. Prikl. Fotogr. i Chim. 25, 102 (1980).
255. Dill F. H., Shaw J. M.: IBM J. Res. Develop. 21, 210 (1977).
256. Kuthan J., Kurfürst A.: Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Develop. 21, 191 (1982). Nakamura Y., Yamamoto S., Kormine T., Asaumi S., Yokota A., Nakane H.: Nippon Kogaku Kaishi 2, 321 (1984).
257. Delzenne G. A., Laridon V., Peeters H.: Eur. Polymer J. 6, 993 (1970).
258. Förster T.: Z. Electrochem. 50, 42 (1950).
259. Weller A.: Z. Electrochem. 56, 662 (1952).
260. Bartok W., Hartman R., Luschesi P.: Photochem. Photobiol. 4, 449 (1965).
261. Morrison G. A.: *Chimija nitro-n nitrozogrupp* (Foyer G., Edit.). Chimija, Moskva 1972.
262. Barzynski H., Sängler D.: Angew. Makromol. Chem. 93, 131 (1981).
263. Beljakova A. P., Bokov J. S., Lavrišev V. P., Konovalov P. G., Vaskevič D. N.: Vysokomol. Sojed. 8, 910 (1966).
264. Shirai M., Tanaka M.: J. Appl. Polym. Sci. 17, 1617 (1973).
265. Petropoulos C.: J. Polym. Sci. A15, 1637 (1977).
266. Tudös F., Kende I., Berežnych T., Solodovnikov S. P., Vojvodskij V. V.: Kinetika i kataliz 6, 203 (1965).
267. Cox A., Kemp T. J., Payne D. R., Symons M. C. R., de Moira P. P.: J. Amer. Chem. Soc. 100, 4779 (1978).
268. Oikawa S., Tsuda M., Nogami A., Kouno Y., Fujimoto Y.: Photogr. Sci. Eng. 27, 123 (1983).
269. Becker H. G. O.: Wiss. Z. Technische Hochschule Leuna-Merseburg 20, 253 (1978).
Timpe H. J., Israel G., Becker H. G. O.: Chem. Phys. Lett. 99, 275 (1983).
270. Porter N. A., Dubay G. R., Green J. G.: J. Amer. Chem. Soc. 100, 920 (1978).
271. Tsunoda T., Yamaoka T.: J. Appl. Polym. Sci. 8, 1379 (1964).
272. Dolgoplosk B. A., Tinjakova E. I.: *Generirovanije svobodnych radikalov i ich reakciji*. Nauka, Moskva 1982.
273. Patais L., Edit.: *The Chemistry of Azido Group*. Interscience, New York 1974.
274. Lwowski W., Edit.: *Nitrenes*. Interscience, New York 1970.

275. Lavriščev V. P.: *Vvedenije v fotolitografiju*. Energija, Moskva 1977.
Tsuda M., Oikawa S., Yokota A., Yabuta M., Wataru K., Kashiwagi K.: *Polym. Eng. Sci.* 23, 993 (1983).
276. Nonogaki S.: *Polymer Eng. Sci.* 23, 259 (1984). De Forest W. S.: *Photoresists: Materials and Processes*. McGraw-Hill, New York 1975.
277. Bokov J. S.: *Foto-, elektronno- i rentgenorezisty*. Radio i svjaz, Moskva 1982.
278. Alvarado R., Grivet J. P., Igier C.: *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* 73, 844 (1977).
279. Leysbon L. J., Reiser A.: *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* 68, 1918 (1972).
280. Stankovský S., Kovacz S.: *Chem. Zvesti* 28, 243 (1974).
281. Smirnov V. A., Brichkin S. B.: *Chem. Phys. Lett.* 87, 548 (1982).
282. Jelcov A. V., Jurre T. A., Kokurina A. M.: *Ž. Prikl. Chim.* 50, 2540 (1977).
283. Clecak N. J., Cox R. J., Moren W. M.: *Polym. Eng. Sci.* 14, 491 (1974).
284. Guk E. G., Jelcov A. V., Šuman V. B., Jurre T. A.: *Fotorezisty – diffuzanty. v poluprovodnikovoj tehnologiji*. Nauka, Leningrad 1984.
285. Bričkin S. B., Smirnov V. A., Alfimov M. V.: *Chim. Vysokich Energij* 14, 23 (1980).
286. Sumitani M., Nagakura S., Joshihara K.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 49, 2995 (1976).
Nakane H., Yokota A., Yamamoto S., Kanai W.: *Polym. Eng. Sci.* 23, 1050 (1983).
287. Elkasaly M. A.: *Indian J. Chem.* 19B, 1080 (1980).
288. Tamura S., Imaizumi H., Hashida J.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 54, 301 (1981).
289. Tsuda M., Oikawa S., Nagayama K.: *Photogr. Sci. Eng.* 27, 118 (1983).
Tsuda M., Oikawa S., Yabuta M., Yokata A., Nakane H.: *Jap. J. Appl. Phys.*, Part 1, 23, 259 (1984).
290. Lewis F. D., Sander W. H.: *J. Amer. Chem. Soc.* 89, 645 (1967).
291. Lewis F. D., Sander W. H.: *J. Amer. Chem. Soc.* 90, 7031 (1968).
292. Lewis F. D., Dalton J. C.: *J. Amer. Chem. Soc.* 91, 5260 (1969).
293. Reiser A., Wagner H. M., Marley R.: *Trans. Faraday Soc.* 63, 2404 (1967).
294. Jelcov A. V. (Edit.): *Fotohimičeskije reakciji v slojach*. Chimija, Leningrad 1978.
Uwajanagi T., Hashimoto M., Nonogaki S., Koibuchi S., Nakino D.: *Polym. Eng. Sci.*, 23, 935 (1983).
295. Jamaoka T., Kashiwagi H., Nagaura S.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 45, 361 (1972).
296. Kashiwagi H., Iwata S., Jamaoka T.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 46, 417 (1973).
297. Shimizu S., Bird G. R.: *J. Electrochem. Soc.* 124, 1394 (1977).
298. Jamaoka T., Tsunoda T., Koseki K.: *ACS Symposium Series* 115, 186 (1980).
299. Iwagaki M., Shingaki T.: *Chem. Lett.* 1982/1, 9.
300. Chapman O. L., Sheridan R. S., Le Roux J. P.: *J. Amer. Chem. Soc.* 100, 622 (1978).
301. Kitamura T., Tsunashima S., Sato S.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 54, 54 (1981).
302. Hamada J., Tsunashima S., Sato S.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 55, 1739 (1982).
303. Reiser A., Leyshon L. J.: *J. Amer. Chem. Soc.* 92, 7487 (1970).
304. Shimizu S., Bird G. R.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 273 (1979).
305. Jurre T. A., Šaburov V. V., Jelcov A. N.: *Ž. Vses. Chim. Obšč.* 19, 412 (1974).
306. Hapishi J., Swern D.: *J. Amer. Chem. Soc.* 95, 2041 (1973).
307. Stuber F. A., Ulrich H., Rao D. V.: *Photogr. Sci. Eng.* 17, 446 (1973).

308. Dubrovskaja S. I., Jurre T. A.: *Ž. Prikl. Chim.* 51, 160 (1978).
309. Jelcov A. V., Jurre T. A.: *Ž. Prikl. Chim.* 52, 365 (1979).
310. Reiser A., Leyshon L. J., Johnston L.: *Trans. Faraday Soc.* 67, 2383 (1971).
311. Agaki M., Nomogaki S., Kohashi T.: *Polym. Eng. Sci.* 23, 353 (1977).
312. Kohashi T., Agaki M., Nomogaki S.: *Photogr. Aci. Eng.* 23, 168 (1979).
313. Efros L. S., Jurre T. A., Darovskij T. T.: *Elektron. Techn.* 1972, ser. 2/7, 5.
314. Harita J., Ishikawa M., Harada K.: *Polym. Eng. Sci.* 17, 372 (1977).
315. Tsunoda T., Yamaoka T.: *Photogr. Sci. Eng.* 20, 188 (1976).
316. Tsunoda T.: *Photogr. Sci. Eng.* 23, 172 (1979).
317. Ulrich H., Stuber F. A., Peters G. M.: *J. Polymer. Sci.* A14, 565 (1976).
318. Zimmerman R. E.: *Science* 153, 837 (1966).
319. Zimmerman R. E.: *Pure Appl. Chem.* 9, 493 (1964).
320. *Organic Photochemistry*. 3. vyd. Dekker, New York 1973.
321. Reiser A., Egerton P. L.: *Photogr. Sci. Eng.* 23, 144 (1978).
322. Egerton P. L., Pitts E., Reiser A.: *Macromolecules* 14, 95 (1981).
323. (Patai S., Edit.). *The Chemistry of Alkenes* Interscience, New York 1966.
324. Zimmerman R. E., Swenton L. S.: *J. Amer. Chem. Soc.* 86, 1436 (1964).
325. Shinde J., Horia K., Mita I.: *Chem. Lett.* 1983, 639.
326. Egerton P. L., Hyde E. M., Trigg J. F.: *J. Amer. Chem. Soc.* 103, 3859 (1981).
327. Beynon P., Payne A. W., Trigg J. F.: *J. Photogr. Sci. Eng.* 30, 23 (1982).
328. Schmidt G. M.: *Pure Appl. Chem.* 27, 647 (1971).
329. Cohen M. M.: *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* 14, 386 (1975).
330. Ninomya A., Nisqhiwaki T., Anda K.: *Bull. Techn. Assoc. Graphs Acts. Jap.* 19, 113 (1981).
331. Mustafa M.: *Chem. Rev.* 51, 1 (1952).
332. Minsk L. M.: *J. Appl. Polym. Sci.* 2, 302 (1959).
333. Tsuda M.: *Bull. Chem. Soc. Jap.* 42, 905 (1969).
334. Delzenne G. A.: *J. Macromol. Sci. Rev. Polym. Technol.* 1, 185 (1971).
335. Robertson R. M.: *J. Appl. Polym. Sci.* 2, 308 (1959).
336. Ranby B., Rabek J.: *Fotodestrukcija, fotookislenije, fotosensibilizacija polimerov*. Mir, Moskva 1978.
337. Tsuda M.: *J. Soc. Sci. Photogr. Jap.* 32, 51 (1969).
338. Reiser A., Pitts N.: *Photogr. Sci. Eng.* 20, 225 (1976).
339. Steppan R., Buhr G., Vollmann H.: *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* 21, 455 (1982).
340. Getes A. P.: *Photogr. Sci. Eng.* 22, 16 (1978).
341. Tanaka H., Tauda M., Nakanishi H.: *J. Polym. Sci.* A10, 1729 (1972).
342. Scheffer J. R., Wastradowski R. A., Dooby K. C.: *Chem. Commun.* 1971, 1217.
343. Unruh C. C., Smith A. C.: *J. Appl. Polym. Sci.* 3, 310 (1960).
344. Tsuda M.: *J. Polym. Sci.* A2, 2907 (1964).
345. Mitsuno T., Hattori S., Tawata M.: *J. Opt. Soc. Amer.* 67, 1651 (1977).
346. De Schrijver F. C., Boens N.: *J. Oil Coll. Chem. Assoc.* 59, 171 (1976).
347. Zweifel H.: *Photogr. Sci. Eng.* 27, 114 (1983).
348. De Boer C. P.: *J. Polym. Sci., Poly. Lett.* 11, 25 (1973).
349. Lin B. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 12, 1317 (1975).
350. Lin B. J.: *IBM J. Res. Develop.* 20, 213 (1976).

351. Mimira Y., Ohkubo T., Takeuchi T., Sekikawa K.: *Jap. J. Appl. Phys.* *17*, 541 (1978).
352. Tsuda M., Oikawa S., Nakamura Y., Nagata A., Nakane H., Yokota A., Tsumori T., Nakane Y.: *ACS Symposium Series* 121, 281 (1980).
353. Vajner A. J., Pakimenko A. N., Limanova V. F., Dumajev K. M.: *Mikroelektronika* *113*, 311 (1984).
354. Hirakoka H., Welsh W. Z., Bargon J.: *J. Vac. Sci. Technol.*, *1*, 1062 (1983).
355. Mimira Y., Ohkubo T., Takeuchi T., Sekikawa K.: *Proc. 12th Symp. Semiconductor and Integrated Circuits Technol., The Electrochem. Soc. of Japan*, s. 54, Tokyo, květen 1977. Yamashita Y., Ogura K., Kunishi M., Kawazu R., Ohno S., Mizokami Y.: *J. Vac. Sci. Technol.* *16*, 2026 (1979).
356. Chandross E. A., Reichmanis E., Wilkins C. W., Hartless R. L.: *Solid State Technol.* *24*, 81 (1981).
357. Wilkins C., Reichmanis E., Chandross E. A.: *J. Electrochem. Soc.* *127*, 2510 (1980).
358. Reichmanis E., Wilkins C., Chandross E.: *J. Electrochem. Soc.* *127*, 2514 (1980).
359. Hartless R. L., Chandross E. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* *19*, 1333 (1981).
360. Tsuda M., Oikawa S., Nakamura Y., Nagata H., Yokota A., Nakane H., Tsumori T., Nakane Y., Mifune T.: *Photogr. Sci. Eng.* *23*, 290 (1979).
Kinoshita A., Namarizama V., Higashi H., Meahara H.: *Nippon Shashi Gakkaishi* *46*, 395 (1983).
361. Bowden M. J., Phompson L. F.: *Solid State Technol.* *21*, 1394 (1978).
362. Nate T., Kabayashi T.: *J. Electrochem. Soc.* *128*, 1394 (1981).
363. Hioraka H., Welesh L. W.: *Organics Coatings and Appl. Polym. Sci.* *48*, 48 (1983).
364. Himics R. J., Ross D. L.: *Polym. Eng. Sci.* *17*, 350 (1977).
365. Jain K., Willson C. G., Lin B. J.: *IEEE Electron Dev. Lett.* *3*, 53 (1982).
366. Grant B. D., Clecak N. J., Twieg R. J., Willson C. G.: *IEEE Trans. Electron Devices* *ED-28*, 1300 (1981).
367. Dill F. H., Hornberger W. P., Hauge P. S., Shaw J. M.: *IEEE Trans. Electron Devices* *ED-22*, 445 (1975).
368. Reichmanis E., Wilkins C. W., Chandross E. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* *19*, 1338 (1981).
369. Wilkins C. N., Reichmanis E., Chandross E. A.: *J. Electrochem. Soc.* *129*, 2552 (1982).
370. Crivello J. V.: *Organics Coatings and Appl. Polym. Sci.* *48*, 65 (1983).
371. Ito H., Willson C. G.: *Organics Coatings and Appl. Polym. Sci.* *48*, 60 (1983).
372. Iwayanagi T., Kohashi T., Nonogaki S.: *J. Electrochem. Soc.* *127*, 2759 (1980).
Tsuda M., Oikawa S., Yabuta M., Yokota A., Nokane H.: *Jap. J. Appl. Phys., Part. I*, *23*, 259 (1984).
373. Iwayanagi T., Kohashi T., Nonogaki S., Matsuzawa T., Douta K., Yanazawa H.: *IEEE Trans. Electron Devices* *ED-28*, 1306 (1981).
374. Kerwin R. E., Goldrik M. R.: *Polym. Eng. Sci.* *11*, 426 (1971).
375. Rubner R., Ahne H.: *Photogr. Sci. Eng.* *23*, 303 (1979).
376. Bowden M. J., Thompson L. F.: *Polym. Eng. Sci.* *17*, 269 (1977).
377. Hiraoka H.: *J. Electrochem. Soc.* *128*, 1065 (1981).

378. Taylor G. N., Wolf T. M.: *J. Electrochem. Soc.* 127, 2665 (1980).
379. Penn T. C.: *IEEE Trans. Electron Devices ED-26*, 640 (1979).
380. Tsuda M., Oikawa S., Kanai W., Yokota A., Hijikata I., Vehars A., Nakane H.: *J. Vac. Sci. Technol.* 19, 259 (1981).
381. Korzo V. F., Kuročkin V. A., Demin V. P.: *Plenki iz elementoorganičeskich sojedinenij v radioelektronike*. Energija, Moskva 1973.
382. Bočkans P. L., Pundur P. J., Feltyň I. J.: *Izv. Litev. Akad. Nauk SSR, Ser. Fiz. Techn.* 1973/5, 37.
383. Bočkans P. L., Dubrovskaja A. S., Pundur P. J.: *Izv. Akad. Nauk SSR, Ser. Fiz. Techn.* 1973/5, 42.
384. Beyer K. D.: *J. Electrochem. Soc.* 123, 1556 (1976).
385. Mar K. M.: *J. Electrochem. Soc.* 126, 1252 (1979).
386. Beyer K. D.: *J. Electrochem. Soc.* 124, 630 (1977).
387. Jelcov A. V., Jurre T. A., Guk Je. G.: *Ž. Techn. Fiz.* 1, 571 (1975).
388. Jurre T. A., Jelcov A. V., Busygina L. A.: *Chimija i tehnologija elementoorganičeskich sojedinenij i polimerov*. KCHTI, Kazaň 1981.
389. Jelcov A. V., Jurre T. A., Guk E. G.: *Voprosy radioelektroniki, Ser. TRO* 1977/1, 55.
390. Pastor A. S., Tangonan G. L., Pastor R. C.: *Thin Solid Films* 67, 9 (1980).
391. Brit. pat. 2 026 709.
392. Brit. pat. 2 020 837.
393. Brit. pat. 1 563 010.
394. Nikančikova E. A., Popova A. L.: *Technologija ofsetnogo proizvodstva*. Kniga, Moskva 1978.
395. Lapatuchin V. S.: *Sposoby pečati*. Kniga, Moskva 1976.
396. Markova V. N.: *Ploskaja pečaf bez uvlažnjenja*. Izd. Moskovskogo tehnologičeskogo instituta, Moskva 1974.
397. *Revue ATYP* 28/3, 139 (1974),
398. Andrejeva V. I., Markova N. V., Beskov V. V.: *Trudy VNIKPP* 30, 41 (1980).
399. Beskov V. V., Markova N. V., Andrejeva V. I.: *Poligrafija* 1978/4, 13.
400. US pat. 4 292 397.
401. Shimokawa J.: *Austral. Lithogr. Print. Packing* 13, 18 (1980).
402. Jacot C. M.: *Typograph. Monatsch.* 100, 54 (1981).
403. Solda J.: *Typografia* 85, 28 (1982).
404. Kokurina A. M.: *Autoreferát kandidátské disertační práce*. Leningradskij tehnologičeskij institut im. Lensověta, Leningrad 1978.
405. US pat. 3 205 157.
406. Schlesinger S.: *Polym. Eng. Sci.* 14, 513 (1974).
407. Schlesinger S.: *Photogr. Sci. Eng.* 18, 387 (1974).
408. US pat. 3 794 574.
409. Bal T. S., Cox A., Kemp T. J.: *Polymer* 21, 423 (1980).
Bauman H., Timpe H. J., Böttcher H.: *Z. Chemie* 23, 394 (1983).
410. Crivello J. V.: *UV Curing: Science and Technology* (Pappas S., Edit.). Technology Marketing Corp., Stamford 1978.

411. Crivello J. V.: *Developments in Polymer Photochemistry* (Allen N. S., Edit.). Vol. 2. Appl. Sci. Publ., London 1981.
412. Crivello J. V., Lam H. W.: *ACS Symposium Series*. Vol. 114, Amer. Chem. Soc., Washington 1979.
413. Watt W. R.: *ACS Symposium Series*. Vol. 114, Amer. Chem. Soc., Washington 1979.
414. Crivello J. V., Lam J. H.: *Macromolecules* 10, 1307 (1977).
415. Crivello J. V., Lam J. H.: *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.* 17, 977 (1979).
416. US pat. 4 273 668.
417. Crivello J. V., Lam J. H.: *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.* 17, 1047 (1979).
418. Crivello J. V., Lam J. H.: *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.* 18, 1021 (1980).
419. Crivello J. V., Lam J. H.: *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.* 17, 2877 (1979).
420. Crivello J. V., Lam J. H.: *Polymer Preprints* 20, 415 (1979).
421. Pappas S., Gatechair L., Pappas B.: *Photochem.* 17, 120 (1981).
422. Pappas S. P., Pappas B. R., Gatechair L., Schnaber W.: *J. Polymer Sci.* A22, 69 (1984).
- Timpe H. J., Filo P., Bauman H., Strehmel B.: *Z. Chemie* 23, 102 (1983).
423. Pappas S., Jilek J.: *Photogr. Sci.* 23, 140 (1979).
424. Crivello J. V., Lam J. H.: *J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.* 17, 1059 (1979).
425. Crivello J. V., Lam J. H.: *Macromolecules* 14, 1141 (1981).
426. Ketley A. D., Jung-Hsien-Tsao: *J. Radiation Curing* 1979/2, 22.
427. Perkins W. C.: *J. Radiation Curing* 1981/1, 16.
428. Bauman H., Strehmel B., Timpe H. J., Lammel U.: *J. Pract. Chem.* 324, 624 (1984).
429. US pat. 4 193 799.
430. US pat. 4 341 859.
431. US pat. 4 081 276.
432. US pat. 4 241 204.

5.5 LITERATURA

1. Lin B. J.: *Fine Line Litography* (Newman R., Edit.). North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1980.
2. Lin B. J.: *Introduction to Microlithography* (Thompson L. F., Wilsson C. G., Bowden M. J., Edits.). *ACS Symposium Series 219*, ACS, Washington 1983.
3. Lacombat M., Dubroeuq G. M.: *Proc. SPIE 174*, 28 (1979).
4. Walker E. J.: *IEEE Trans. Electron. Devices ED-22*, 464 (1975).
5. Greeneich J. S.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 80/1*, 261 (1980).
6. Spears D. L., Smith H. I.: *Solid State Technol. 15*, 21 (1972).
7. Kakuchi M., Sugawara S., Murase K., Matsugama K.: *J. Electrochem. Soc. 124*, 1648 (1977).
8. Moran J. M., Taylor G. N.: *J. Vac. Sci. Technol. 16*, 2014 (1979).
9. Taylor G. N., Wolf T. M.: *J. Electrochem. Soc. 127*, 2665 (1980).
10. Ryssel H., Haberberger K., Kranz H.: *J. Vac. Sci. Technol. 19*, 1358 (1981).
11. USA pat. 3 873 361.
12. Grebe K., Ames L., Ginzberg A.: *J. Vac. Sci. Technol. 11*, 458 (1974).
13. USA pat. 4 004 044.
14. Havas J. R.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 76/2*, 743 (1976).
15. USA pat. 4 024 293.
16. Hatzakis M.: *J. Vac. Sci. Technol. 16*, 2984 (1979).
17. Grobman R. D., Luhn H. E., Donohue T. P., Speth A. J., Wilson A., Hatzakis M.: *IEEE Trans Electron. Devices ED-26*, 360 (1979).
18. Lin B. J.: *J. Electrochem. Soc. 127*, 202 (1980).
19. Lin B. J., Bassons E., Chao V. W., Petrillo K. E.: *J. Vac. Sci. Technol. 19*, 1313 (1981).
20. Tai K. L., Johnson L. F., Murphy D. W., Chung M. S. C.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 79*, 244 (1979).
21. Tai K. L., Sinclair W. R., Vadimsky R. G., Morgan J. M., Rand M. J.: *J. Vac. Sci. Technol. 16*, 1977 (1979).
22. Vadimsky R. G., Tai K. L.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 80/2*, 824 (1980).
23. Roberts E. D.: *Phillips Techn. Review 35*, 41 (1975).
24. Moran J. M., Maydan D. J.: *J. Vac. Sci. Technol. 16*, 1620 (1979).
25. Lin B. J., Chang T. H. P.: *J. Vac. Sci. Technol. 16*, 1669 (1979).
26. Wats R. K., Fichtner W., Fuls E. N., Thibauet L. R., Johnson R. L.: *Proceedings IEDM 1980*, 772.
27. Kruger J. B., Rissman R., Chang M. S.: *J. Vac. Sci. Technol. 19*, 1320 (1981).
28. Tennant D. M., Jackel L. D., Howard R. E., Hu E. L., Brabbe P., Capik R. J.: *J. Vac. Sci. Technol. 19*, 1304 (1981).
29. O'Toole M. M., Lin E. D., Chang M. S.: *Proceeding SPIE 275*, 128 (1981).
30. Ray G. W., Peng S., Burriesci D., O'Toole M. M., Lin E. D.: *J. Electrochem. Soc. 129*, 2152 (1982).
31. Lin B. J., Chao V. W., Kaufman F. B., Kramer S. R.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 82*, 275 (1982).

32. Batchelder W. T., Tahemoto C.: *Semicond. International* 7, 213 (1981).
33. Griffing B. F., Johnson P. D., Norton J. F.: *Proceedings SPIE* 275, 136 (1981).
34. Hatzakis M.: *IBM J. Res. Develop.* 24, 452 (1980).
35. USA pat. 4 212 935.
36. Halverson R. M., MacIntryre M. W., Motsiff W. T.: *IBM J. Res. Develop.* 26, 590 (1982).
37. Collins G. G., Halsted C. W.: *IBM J. Res. Develop.* 26, 596 (1982).
38. Batchelder W. T.: *Solid State Technol.* 25/2, 112 (1982).
39. Matsuzawa T., Tomioka H.: *IEEE Trans. Electron. Devices* ED-28, 1284 (1981).
40. Griffing B. F., West P. R., Heath B. A.: *IEEE Electron. Devices Lett.* EDL-4, 14 (1983); *ibid.* EDL-4, 317 (1983).
41. Lin B. J.: *IEEE Trans. Electron Devices* ED-25, 419 (1978).
42. Deckert C. A., Peters D. A.: *Kodak Microelectronics Seminar Proceedings*. Kodak, Rochester, October 1977.
43. Baddour R. F., Timmins R. S.: *The Application of Plasmas to Chemical Processing*. MIT Press, Cambridge 1967.
44. Hollahan J. R.: *Techniques and Application of Plasma Chemistry*. Wiley, New York 1974.
45. Venugopalan M.: *Reactions under Plasma Conditions*. Wiley, New York 1971.
46. Kay E., Coburn J., Dilks A.: *Topics Curr. Chem.* 94, 1 (1980).
47. Chapman B. N.: *Glow Discharge Processes*. Wiley, New York 1980.
48. Ephrath L. M., DiMaria D. J.: *Solid State Technol.* 24/4, 182 (1981).
49. Winters H. F.: *Topics Curr. Chem.* 94, 69 (1980).
50. Bell A. T.: *Solid State Technol.* 21/4, 89 (1978).
51. Lehman H. W., Widmer R. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 319 (1978).
52. Bondur J. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* 15, 1023 (1978).
53. Melliar-Smith C. M., Magab C. J.: *Thin Film Processes* (Vossen J. L., Kern W., Edits.). Academic Press, New York 1980.
54. Horiike H. W., Shibagaki M.: *Semiconductor Silicon 1977* (Ruff H. R., Sirth D. L., Edits.). The Electrochemical Society, Washington 1977.
55. Coburn J. W., Kay E.: *IBM J. Res. Develop* 23, 33 (1978).
56. Flamm D. L.: *Plasma Chem. Plasma Processing* 1, 37 (1981).
57. Flamm D. L., Donnelly V. M., Mucha J. A.: *J. Appl. Phys.* 52, 3633 (1981).
58. Mogab C. J.: *J. Electrochem. Soc.* 128, 1262 (1981).
59. van de Wen E. P. G. T., Zijlstra P. A.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts* 80/81, 253 (1980).
60. Howarth R., Zarowin C. B., Rosenberg R.: *Electrochem. Soc. Extended Abstracts* 80/81, 294 (1980).
61. Boyd H., Tang M. S.: *Solid State Technol.* 25/4, 133 (1979).
62. Flamm D. L., Cowen P. L., Golovachenko J. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* 17, 1341 (1980).
63. d'Agostino R., Flamm, D. L.: *J. Appl. Phys.* 52, 162 (1981).
64. Flamm D. L., Wang D. N. K., Maydan D. J.: *J. Electrochem. Soc.* 129, 2775 (1982).
65. Mogab C. J., Levenstein H. J.: *Vac. Sci. Technol.* 17, 721 (1980).

66. Adams A. C., Capio C. D.: *J. Electrochem. Soc.* *128*, 366 (1981).
67. Heinecke R. A. H.: *Solid State Electron.* *19*, 1039 (1976).
68. Matsuo S.: *J. Vac. Sci. Technol.* *17*, 587 (1980).
69. Reinberg A. R., Dalle Ave J., Steinberg G., Bruce R.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 81/2*, 669 (1981).
70. Donnelly V. M., Flamm D. L., Tu C. W., Ibbotson D. E.: *J. Electrochem. Soc.* *129*, 2553 (1982).
71. Smolinsky G., Chang R. P., Mayer T. M.: *J. Vac. Sci. Technol.* *18*, 12 (1981).
72. Klinger R. E., Greene J. E.: *Appl. Phys. Lett.* *38*, 620 (1981).
73. Hu E. L., Howard R. E.: *Appl. Phys. Lett.* *17*, 1022 (1980).
74. Donnelly V. M., Flamm D. L., Collins C. J.: *J. Vac. Sci. Technol.* *21*, 817 (1982).
75. Coldren L. A., Rentschler J. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* *19*, 225 (1981).
76. Bösh M. A., Coldren L. A.: *Appl. Phys. Lett.* *38*, 264 (1981).
77. Poulsen R. G.: *J. Vac. Sci. Technol.* *14*, 266 (1977).
78. Herb G. K., Porter R. A., Cruzan P. D., Agraz-Guerena J., Soller B. R.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 81/2*, 710 (1981).
79. Hess D. W.: *Plasma Chem. Plasma Processing 2*, 141 (1982).
80. Nakata H., Nishioka K., Abe H.: *J. Vac. Sci. Technol.* *17*, 1351 (1980).
81. Mogab C. J., Shankoff T. A.: *J. Electrochem. Soc.* *124*, 1766 (1977).
82. Harada T., Gamo K., Namba S.: *Jap. J. Appl. Phys.* *20*, 259 (1981).
83. Randall J. N., Wolfe J. C.: *Appl. Phys. Lett.* *39*, 742 (1981).
84. Legat W. H., Schillings H.: *Electrochem. Soc., Extended Abstracts 75/2*, 336 (1975).
85. Parry P. D., Rodde A. F.: *Solid State Technol.* *22/4*, 125 (1979).
86. Lehmann H. W., Widmer R.: *Appl. Phys. Lett.* *32*, 163 (1978).
87. Jinno K.: *Jap. J. Appl. Phys.* *17*, 1283 (1978).
88. Battey J. F.: *IEE Trans. Electron Devices ED-24*, 140 (1977).
89. Kegel B.: *Circuits Manuf.* *21*, 27 (1981).
90. Taylor G. N., Wolf T. M.: *J. Electrochem. Soc.* *127*, 2665 (1980).
91. Taylor G. N., Wolf T. M., Moran J. M.: *J. Vac. Sci. Technol.* *19*, 872 (1981).
92. Tamamura T., Imamura S., Sugawara S.: *Org. Coatings and Appl. Polymer Sci.* *48*, 150 (1983).
93. Taylor G. N., Wolf T. M.: *Polym. Eng. Sci.* *20*, 1086 (1980).
94. Flamm D. L., Donnelly V. M.: *Plasma Chem. Plasma Processing 1*, 317 (1981).
95. Tu Y. Y., Chuang T. J., Winters H. F.: *Phys. Rev. B* *23*, 823 (1981).
96. Adams A. C., Capio C. D.: *J. Electrochem. Soc.* *128*, 366 (1981).
97. Marcoux P. J., Foo P. W.: *Solid State Technol.* *24/4*, 115 (1981).
98. Busta H. H., Lajos R. E., Kiewit D. A.: *Solid State Technol.* *22/2*, 61 (1979).
99. Kleinknecht H. P., Meier H. J.: *J. Electrochem. Soc.* *125*, 798 (1978).
100. Harshbarger W. R., Porter R. A., Miller T. A., Norton P. J.: *Appl. Spectrosc.* *31*, 2201, (1977).
101. d'Agostino R., Cramarossa F., DeBenedictis S., Ferraro G.: *J. Appl. Phys.* *52*, 1259 (1981).
102. Raby B. A.: *J. Vac. Sci. Technol.* *15*, 205 (1978).
103. Oshima M.: *Jap. J. Appl. Phys.* *17*, 579 (1978).

104. Chen F. F.: *Plasma Diagnostic Techniques* (Huddleston R. H., Leonard S. L., Edits.). Academic Press, New York 1965.
105. Swift J. D., Schwar M. J. R.: *Electris Probes for Plasma Diagnostics*. Elsevier, New York 1961.
106. Baker C., Baker A. D., Brundle C. R.: *Molecular Photoelectron Spectroscopy*. Wiley, New York 1970.
107. Chuang T. J.: *J. Appl. Phys.* 51, 2614 (1980).
108. Carlson T. A.: *Photoelectron and Auger Spectrography*. Plenum Press, New York 1970.
109. Miller T. A.: *Plasma Chem. Plasma Processing I*, 3 (1981).
110. Hargis P. J., Jr., Kusher M. J.: *Appl. Phys. Lett.* 40, 779 (1982).
111. Heaven M., Miller T. A., Freeman R., White J., Bokor J.: *Chem. Phys. Lett.* 86, 458 (1982).
112. Vossen J. L., Kern W.: *Thin Film Processes*. Academic Press, New York 1978.
113. Bollinger D., Fink R.: *Solid State Technol.* 23/11, 79 (1980).
114. Downey D. F., Bottoms N. R., Hanley P. R.: *Solid State Technol.* 24/2, 121 (1981).
115. Mayer T. M., Barker R. A.: *J. Electrochem. Soc.* 129, 585 (1982).
116. Selivanov G. K., Mšenskaja T. A., Možžuchin D. D., Gribov B. G.: *Mikroelektronika* 13/4, 291 (1984).
117. Jap. pat. 81 95 903.
118. Jap. pat. 82 63 827.
119. Morita M., Imamura S., Tamamura T., Kogure O., Murase K.: *J. Vac. Sci. Technol. B I*, 1171 (1983).
120. Fritzsche C. R.: *J. Appl. Phys.* 53, 9053 (1982).
121. Jap. pat. 83 140 121.
Schreiber H. P., Klemmberg-Sapieha J. E., Sacher E., Weitheimer M. R.: *Polymer Mat. Sci. Eng.* 53, 839 (1985).
122. Hattori S., Tomano J., Ieda M., Morita S.: *Symp. Proc. Int. Symp. Plasma Chem. 6th* 2, 532 (1983).
123. Pederson L. A.: *J. Electrochem. Soc.* 129, 205 (1982).
124. Morita S., Hattori S., Ieda M., Tomano J., Yamada: *Kobunshi Ronbushu* 38, 657 (1981).
125. Morita S., Yoneda K., Ishibashi S., Tomano J., Yamada Y., Hattori S., Ieda M.: *Symp. Proc. Int. Symp. Plasma Chem. 5th* 1, 259 (1981).
126. Hattori S., Morita S., Yamada M., Tomano J., Ieda M.: *Polym. Eng. Sci.* 23, 1043 (1983).
127. Jap. pat. 83 108 205.
128. Jap. pat. 83 107 535.
129. Jap. pat. 82 180 134.
130. Wolfgang E.: *Microcircuit Engineering* (Nixon W. C., Ahmed H., Edits.). Cambridge University Press, Cambridge 1980.
131. SSSR pat. 605 155.
132. Gerasimov B. G., Gurov S. A., Erlich R. D., Djumajev K. M.: *Chim. Prom.* 1981/10, 40.
133. Anonym: *Semicond. International* 7/10, 116 (1984).